J-PARC RCS 入射部の放射化と残留線量測定

RESIDUAL DOSE MEASUREMENT AND ACTIVATION OF THE INJECTION AREA IN THE J-PARC RCS

吉本政弘^{#, A)},山川恵美^{B)},竹田修^{A)},山本風海^{A)},原田寛之^{A)},Saha Pranab^{A)},岡部晃大^{A)},金正倫計^{A)}

Masahiro Yoshimoto^{#, A)}, Emi Yamakawa^{B)}, Osamu Takeda^{A)}, Kazami Yamamoto^{A)}, Hiroyuki Harada^{A)}, Saha Pranab^{A)},

Kota Okabe^{A)}, Michikazu Kinsho^{A)}

^{A)} Japan Atomic Energy Agency (JAEA) / J-PARC

^{B)} Royal Holloway, University of London (RHUL)

Abstract

In the 3 GeV Rapid Cycling Synchrotron (RCS) of Japan Proton Accelerator Research Complex (J-PARC), we adopted multi-turn H^- charge exchange injection by using stripper foil in order to achieve high power proton beam. It is therefore impossible to neglect the interaction between stripper foil and the beam. As a result, there are high residual dose measured around the stripper foil. Based on detail numerical simulations by using PHITS code, it is identified that the secondary particles produced in the nuclear reactions due to foil beam interaction caused the high residual activity around foil. In this paper, we report a detail measurement of the residual dose around the stripper foil together with the cause estimated based on simulation studies.

1. はじめに

J-PARC 3GeV Rapid Cycling Synchrotron (RCS)では 設計出力 1MW の大強度陽子ビームを実現させるた めに、ハードウェアのアップグレードやビーム調整 を行ってきた。2013 年度にはリニアックのエネル ギーを 181 MeV から 400 MeV に増強し^[1]、それに伴 い RCS においても入射機器のアップグレードを実 施した^[2]。また 2014 年度にはリニアックのピーク電 流を 30mA から 50mA へ増強した^[3]。この後、リニ アック・RCS 共に大強度ビームを用いたビーム試験 を繰り返し実施し、2015年1月10日には設計ビー ム強度である 1MW 相当のビーム出力を達成した^[4]。 RCS において 1MW 大強度陽子ビームを用いた利用 運転を実現するための最大の課題はビームロスによ る機器放射化の低減である。これまでの大強度ビー ム試験を経て、RCS における様々なビームロスの原 因を特定しそれぞれに可能な対策を講じることで、 荷電変換フォイルに起因するビームロス以外はほぼ 全て抑制し最小化することが出来た^[4]。

RCS では大強度陽子ビームを実現するために荷電 変換フォイルを用いた Hビーム荷電変換多重入射方 式を採用している。そのため、荷電変換フォイルと ビームとの相互作用は避けようがなく、様々なビー ムロス抑制の措置を講じた今でも、入射部のフォイ ル周辺に非常に高い残留線量が存在している。これ までの詳細な残留線量の分布測定と PHITS によるシ ミュレーション結果から、荷電変換フォイルからの 2 次粒子(陽子及び中性子)がフォイル周辺の放射 化の主な原因であることが分かってきた^[5,6]。本論文 では、RCS 入射部における放射化の状況とその原因 について、そしてフォイル周辺の残留線量低減に向 けた対策について報告する。

Figure 1 は 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大 震災による被災からの復旧後から本年度 2015 年度 夏期停止期間まで(Run 41~#63)のリニアックから RCS に入射された HFビームの粒子数の推移をグラ フにした結果を示している。下図は1時間毎の積算 量をグラフにしたもので、おおよそ RCS のビーム 出力パワーに比例している。上図は、1 時間毎の積 算量を積分し、使用したフォイル毎の総積算量の推 移をグラフにしたものである。但し、ビーム入射期 間中に荷電変換フォイルに照射されるビームはリニ アックから入射される Hビームの他に RCS で周回 している H⁺ビームも含まれる。周回する H⁺ビーム のフォイル衝突回数は、入射 Hビームのサイズ、 フォイルのサイズ、入射位置、ペイント入射条件等 により異なるが、確実に入射 H ビームよりも多くな ることに注意が必要である。

Figure 1 の上図を見ても分かるように、上記の 4 年間で加速器利用運転に使用した荷電変換フォイル の枚数は全部で5枚であった。RCSに設置している 第1 荷電変換装置は、予備も含めた利用運転用の フォイルとビーム試験用のフォイルを合わせて15 枚の荷電変換フォイルを真空容器内に収納しており、 遠隔且つ自動でフォイル交換ができるシステムに なっている[7]。この15枚のセットを毎年夏期ビー ム停止期間中にまとめて交換して運用している。実 際に利用運転中に荷電変換入射に使用するフォイル は、これまでは1年毎のサイクルにつき1枚で破損 させずに十分持ちこたえることができた。しかし、 利用運転のビーム強度が増強するに従い、フォイル の劣化が早くみられるようになった。そのため、 2015 度前半の利用運転では、初めて夏期ビーム停止 期間を待たずに利用運転用のフォイル交換を実施し

^{2.} 荷電変換フォイルの照射履歴

[#] yoshimoto.masahiro@jaea.go.jp



Figure 1: Trend plots of the injection H⁻ particle numbers into the RCS after the recovery works from the damages caused by the Great East Japan Earthquake on March 11, 2011. Lower plots: each color line classified under the run number of the user operation shows the particle numbers per hour. Upper plots: (a) ~ (e) lines show the integrated particle number per every stripper foil.



(195µg/cm², 40mm) (205µg/cm², 20mm) (300µg/cm², 40mm) (340µg/cm², 30mm) (340µg/cm², 20mm) Figure 2: Photographs of the 1st stripper foils to compare between before (uppers) and after beam irradiation (lowers).



Figure 3: Measurement results of residual radioactivity at the injection area with a GM survey meter after Run 46 with the injection energy of 181 MeV and the output beam power of 300 kW, after Run 56 with 400 MeV and 300 kW, and after Run 61 with 400 MeV and 400 kW.

Proceedings of the 12th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 5-7, 2015, Tsuruga, Japan

PASJ2015 THP011

ている。Figure 2 は、これまで使用した 5 枚の荷電 変換フォイルの観測系で観察している画像を示した ものである。フォイルの膜厚は入射ビームのエネル ギー増強にともない、設計値 200 µg/cm² から 340 ug/cm²に変更した。またフォイルの幅はリニアック でのビームサイズ調整の向上に伴い、40 mm から 30 mmや20 mmへと小さなものに変更していった。同 時に Figure 2 では、ビーム照射によるフォイルの変 化を見ることを目的として、照射前後の画像を並べ て示した。上列はビーム照射前の状態で、下列は ビーム照射が終わった後の状態である。ビーム照射 により荷電変換フォイルが照射部を中心として大き くしわが出来るようにひずんでくる様子がはっきり と観測されている。フォイル劣化の観察と同時に荷 電変換効率の変化も定期的に観測している^[8]。現在 までのところ変換効率からフォイル劣化の兆候はま だ見られていないが、画像からみたフォイル劣化の 度合いからフォイル交換の目安として判断した。

3. フォイル周辺の残留線量

3.1 入射部残留線量の傾向

Figure 3 はビーム停止後に J-PARC の放射線安全 が計測している入射部の残留線量サーベイの結果を 比較しまとめたものである。リニアックのエネル ギー増強そしてピーク電流増強に伴い、残留線量も 高くなっていることがわかる。設計当初から残留線 量が高くなることが想定されていた、リングコリ メータや H⁰ ビームダンプ周辺を除くと、入射部に は大きく分けて次の3か所に残留線量の高い箇所が 見られた(Figure 3 の緑色で囲まれた箇所を参照)。 つまり、(1)入射分岐ダクト周辺、(2)第1荷電変換 フォイル周辺、(3)H⁰ ダンプライン分岐ダクト周辺、 の3か所である。このうち(1)箇所及び(3)箇所につい ては、比較的早くから残留線量を作るビームロスの 原因について理解が進んでいた。(1)箇所については、 リニアックから入射される H 粒子が荷電変換フォイ ルに到達する前に残留ガス等により H⁰ 粒子に変換 されることで、入射セプタム電磁石で入射軌道に曲 げられずに真空容器に直接照射されることが高い残 留線量を生み出す原因であると考えられる^[9]。そこ で残留ガスを抑制するために、入射ライン上にター ボ分子ポンプを増強し、真空容器内の圧力をさげる ための対策を行った。但し、現状の真空圧力の向上 では多少の改善はみられるものの残留線量を劇的に 減少させるまでには至っていない。 (3)箇所につい ては、荷電変換フォイルに照射された荷電粒子の大 角度散乱によるビームロスが原因であった^[10]。本来 フォイルで散乱されたビームはリングコリメータで 回収できるように設計されていた。しかし RCS の ような大強度陽子ビームの場合、統計的に見ても極 僅かな大角度散乱の粒子ですら現実的には無視でき ない数にのぼり、コリメータまでの間にいくつある 僅かにアパーチャーの狭くなった箇所でロスするこ とで大きな残留線量を発生させていることが分かっ た。そこで、H⁰ダンプヘビームを輸送するダンプセ プタム電磁石内に組み込んである分岐ダクトに対し

て、鉄遮蔽体を積み、且つ大角度散乱されたビーム を集中的に回収できるように改造して、局所的なコ リメータにアップグレードさせた。この局所的なコ リメータの位置及び角度を微調整することで、分岐 ダクトから下流の残留線量は大幅に抑制することが 出来た^[10]。一方で、(2)箇所の強い残留線量について は、大角度散乱によるビームロスでは説明がつかず、 フォイル周辺の放射化の原因はわからなかった。



Figure 4: Residual dose mapping in detail on Run 61 with 400 MeV and 400 kW. Origin of coordinate is a beam injection point at the 1st stripper foil. (a): Comparison of the inside and the outside of the vacuum chambers at the X–Z plane with Y = 0 mm. (b): Comparison of the top- and the bottom-side of the vacuum chamber at the Y–Z plane with X = 0 mm.

3.2 入射部の詳細な残留線量分布測定

入射部の(2)箇所での放射化の原因を探ることを目 的として、改めて入射部の残留線量の詳細な分布測 定を実施した。第1荷電変換フォイルの位置を中心 に、4 台のシフトバンプ電磁石及び 2 台の四極電磁 石に設置しているセラミックスダクトの表面線量を、 ガイガー・ミュラー計数管(GM 管)を用いて測定し た。測定結果をプロットして詳細な残留分布に示し たものが Figure 4 である。上図がセラミックスダク トの上下側の平面中心上の分布を示しており、下図 がセラミックスダクトの内周・外周側の平面中心上 の分布を示している。このうち、内周側の分布(下 図赤丸プロット) にのみ上流側で線量が高くなる箇 所がみられる。これは(1)箇所の残留ガス等による H⁰に変換された入射ビームによる放射化の影響によ るものである。それ以外については、上下側分布及 び内外周側上分布はほとんど同じ傾向を示している。

フォイル直下だけに高い線量があるわけではなく、 ビーム進行方向に高くなる傾向はあるものの、フォ イル位置を中心になだらかで広い範囲に亘る山型分 布をしていることがわかる。もう一つこの残留線量 分布からわかることは、中心付近については上下側 分布の残留線量が高くなっているが、中心から遠ざ かると内外周側分布の残留線量が高くなる、ことで ある。これはシフトバンプ電磁石に設置しているセ ラミックスダクトの形状が水平方向に広い角型ダク トを考慮して、フォイルからみた立体角で評価する ことで理解ができる。口径の小さい上下平面は口径 の大きな内外周平面に比べて、中心付近での立体角 は大きいが、離れると逆転する。以上のことから、 (2)箇所の残留線量の原因は、第1荷電変換フォイル から 180 度ほぼ等方向に放出している「何か」に よって放射化されたことが原因と考えられる。

4. PHITS によるシミュレーション

残留線量の詳細分布から推察される、第1荷電変 換フォイルから前方から後方まで 180 度に亘りほぼ 等方向に放出される「何か」の正体を探るために、 PHITS^[11]モンテカルロ・コード(ver2.64 核データ ファイル JENDL4 利用)を用いたシミュレーション を実施した^[6]。RCS で採用している荷電変換フォイ ルはボロンをドープしたカーボン薄膜(HBC フォイ ル)を採用しており^[7]、PHITS によるシミュレーショ ンにも反映させている。ただし、照射ビームは H⁻粒 子ではなく H⁺粒子を用いている。Figure 5 はフォイ ルで散乱された1次粒子のエネルギー分布及び角度 分布のシミュレーション結果を示したものである。 エネルギーもほとんど入射される 400 MeV から減少 することもなく、またほとんど前方方向にのみ放出 されていることがわかる。このことからも改めて、 荷電変換フォイルでの大角度散乱された粒子が(2)箇 所の放射化の原因ではないことがわかる。



Figure 5: Scattered angle and energy spectrum of primary protons

次に、荷電変換フォイルに H⁺ビームが照射された ときに発生する 2 次粒子についてのシミュレーショ ン結果を見る。入射エネルギーを 181 MeV から 400 MeV に増強すると、発生する 2 次粒子は陽子・中性 子に加えて正負パイ中間子も発生する。また発生し た 2 次粒子のエネルギーも 400 MeV からほとんど 0 MeV までの幅広い範囲に亘っている。ここで、4 種 類の 2 次粒子について、エネルギーを 0 ~ 1 MeV, 1 ~ 50 MeV, 50 ~ 100 MeV, 100 ~ 181 MeV, 181 ~ 300 MeV,300~400 MeV の 6 つ範囲に分けてグループ化 し、それぞれのエネルギーグループについて角度分 布をプロットしたものが Figure 6 である。1 次粒子 と異なり、2 次粒子は角度分布も前方だけでなく後 方 180 度までの広い範囲にわたっており、特にエネ ルギーが低くなるほど等方向に分布していることが 分かる。このことから(2)箇所のフォイル直下での非 常に強い残留線量の原因は、高エネルギー陽子が フォイルに照射された時に生じる核反応によって生 成された 2 次粒子によって放射化されたもの、であ る可能性が高いことがわかる。



Figure 6: Angle distributions of secondary particles on several energy ranges.



Figure 7: Schematic diagrams of the horizontal injection painting scheme. (a-#) shows the beam orbits of the injection and circulating beams in the RCS, and (b-#) shows the beam emittance in the horizontal phase space at the 1st foil. (*-1) and (*-2) shows the injection process without and with the injection painting respectively.

5. 横ペイントのエリアを広げた効果

入射部(2)箇所のフォイル周辺での非常に高い残留 線量は、第1荷電変換フォイルに高エネルギーの ビームが照射されることで核反応が起こり、そこか ら放出される2次粒子によってセラミックスダクト

等周辺機器が放射化されたことによって生じている 可能性が高いことが分かった。RCS のように荷電変 換フォイルを用いた荷電変換多重入射方式を採用し ている限り、フォイルとビームの相互作用による放 射化を完全に消去することは不可能である。一方で、 荷電変換フォイルに照射されるビームは、リニアッ クから入射される H-ビームの他に RCS で周回する H⁺ビームも存在する。この周回する H⁺ビームの フォイルへの照射量を減らすことは、原理的には可 能である。RCS は多重入射によりビーム密度が増え ることで生じる空間電荷効果の影響を緩和させるた めに、ペイントバンプ電磁石を用いた横方向ペイン ト入射方式も合わせて採用している^[4,12]。Figure 7 は 横ペイント入射の原理と効果を示した概念図であり、 横ペイントが無い場合と有る場合を比較したもので ある。横ペイント入射方式では、ビーム入射期間中 に位相空間上の入射ビーム位置は固定しているのに 対して周回ビームの中心位置は時間的に変化させる ことで、多重入射された後の周回ビームが位相空間 上に占める領域を一様に分布させながら広げる手法 のことである(Figure 7 (b-2)参照)。この手法は、 実空間上では周回ビームの中心軌道をフォイルから 遠ざけることと等価である(Figure 7 (a-2)参照)。 ここで横ペイントのエリアを広げることは、ビーム 入射期間中において周回ビームの中心軌道を早く フォイルから遠ざけること等価であることを考慮す ると、横ペイントのエリアを広げることで結果的に 周回ビームのフォイル衝突回数を減らすことが可能 となる。また、フォイルのサイズを小さくしたり ビームの入射位置をフォイル端部に近づけたりする ことも周回ビームのフォイル衝突回数を減らすこと に貢献する。このような様々な努力を積み重ねるこ とで周回ビームの照射回数を減らし、その結果とし てフォイル周辺部の放射化を減らすことが期待でき J^[12]

この効果を実証するために、本年4月に利用運転 のビーム強度を 400 kW から 500 kW に増強すると きに、横ペイントのエリアを 100π mm-mrad から 150π mm-mrad に広げ、またフォイル端部から入射 点までの位置を13 mmから9 mmに近づけた。これ により周回ビームにおいて 1 粒子当たりの平均的な フォイル照射回数は計算上 37.5 回から 18.4 回とほ ぼ半減する。ビーム強度の増強(1.25 倍)を考慮して も放射化の効果はおよそ 6 割まで減少することが期 待できる。Figure 8 は Figure 1 の入射された H-ビー ムの粒子数の推移のプロットを本年度3月から4月 にかけての範囲を拡大したものに、フォイル直下の 残留線量の測定値を合わせたものである。横ペイン トのエリアを広げたことで残留線量は15 mSv/hから 8.5 mSv/h まで減少し、目論み通りの効果を示してい る。また Figure 9 は 400 kW と 500 kW の利用運転後 の残留線量の詳細分布を比較したもので、典型的な 結果として上側平面の分布を示している。ピークだ けでなく分布全体でほぼ一様に減少しており、上下 側分布及び外周側分布ともに積分量で比較すると 6~7 割程度減少していることを確認することが出来 た。(但し、内周側分布は残留ガス等による H^0 ビームのロスを含むため、評価の対象外とした。) 以上の検証結果の成果をもとに考察すると、ビーム 調整をさらに進め横ペイントのエリアを設計値の 216 π mm-mrad まで広げ、フォイルサイズ及び入射 位置の微調整を行うことでフォイル衝突回数は 400 kW 利用運転時に比べて計算上 1/4 程度まで抑える ことが可能となる^[12]。そのため、1 MW 利用運転時 にフォイル周辺で最大 40 mSv/h 程度の残留線量が発 生すると思われていたが、さらなるビーム調整を実 施することで 10 mSv/h 程度と大幅に減らせることが 期待できる。



Figure 8: Trend plots of the injected H^- particle and residual dose measured in about five hours after the beam stop.



Figure 9: Comparison mapping of residual dose in detail on the top-side of the vacuum chamber between the 400 kW operation and 500 kW operation.

6 まとめ

現状、RCS で残っている残留線量の高い箇所は入 射部に集中しており、その中でもフォイル周辺部に 非常に強い残留線量が存在する。詳細な残留線量の 分布測定と、PHITS を用いたシミュレーションの結 果から、フォイル周辺部の残留線量の原因は、高エ ネルギービームがフォイルに照射さることで生じる 核反応によって放出された二次粒子(陽子及び中性

子)であると考えられる。この残留線量を抑制する ために、周回するH⁺ビームとフォイルとの衝突回数 を減らす方法を採用し、その効果を利用運転で確か めた。今後、さらに微細なビーム調整を行い、ペイ ントエリアを広げる、ビームの入射位置をフォイル 端部に近づける、フォイルサイズを小さくする、等 の努力を重ねることで、1 MW ビームでの利用運転 でも残留線量が低く抑えることが期待できる。一方 で入射分岐ダクト周辺の残留線量はビーム強度増強 に比例して増大することが予想される。真空圧力向 上でも劇的に改善しなかったことを考えると、残留 ガス以外にも原因が存在することも考慮する必要が ある。ビーム軌道とビームロスの応答やさらに詳細 な残留分布の調査を行い、引き続き入射部の残留線 量低減に向けた努力を行っていく。

荷電変換フォイルを用いた荷電変換多重入射方式 は、大強度陽子加速器を実現するための非常に優れ た手法であり、世界の多くの加速器で採用されてい る。しかし、これまで荷電変換フォイルで生じる核 反応について定量的な議論はあまりされてなかった。 また生成される広いエネルギー範囲を持つ 2 次粒子 (陽子及び中性子)の放射化の評価もほとんどされ ていない。J-PARC RCS において、ビーム強度の低 いコミッショニング初期からあらゆるビームロスに ついて原因調査とその抑制を徹底したことで初めて この問題を認識し、かつ定量的な評価について議論 するに至った。この成果は荷電変換フォイルを用い る全ての加速器において有意義であると考えられる。 特に2次粒子の放射化に関する評価は、今後の大強 度加速器にとって大きな課題となる。そのため我々 は J-PARC を超えた広い枠組みで、さらなる研究を 進めていく予定である。

参考文献

- [1] K. Hasegawa, Proc. LINAC2014, Geneva, Switzerland: TUIOB03.
- [2] N. Hayashi, et al., Proc. IPAC2013, Shanghai, China: THPWO032.
- [3] K. Hasegawa, JPS Conf. Proc. "Proceedings of the J-PARC Symposium 2014", to be published.
- [4] H. Hotchi., Proc. IPAC2015, Richimond, USA: TUBB3.
- [5] M. Yoshimoto, et al., J. Radioanal. Nucl. Chem., DOI: 10.1007/s10967-015-4138-x.
- [6] E. Yamakawa, et al., JPS Conf. Proc. "Proceedings of the J-PARC Symposium 2014", to be published.
- [7] M. Yoshimoto, et al., J. Phys.: Conf. Ser. 417 (2013), 012073.
- [8] P. K. Saha, et al., J. Radioanal. Nucl. Chem., DOI: 10.1007/s10967-015-4023-7.
- [9] J. Kamiya, et al., Proc. IPAC14, Dresden, Germany: WEPME035.
- [10] S. Kato, et al., Phys. Rev. ST, 16, (2013): 071003.
- [11] T. Sato, et al., J. Nucl. Sci. Technol. 50, 913-923 (2013).
- [12] H. Hotchi., In these proceedings: THOL06.